

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁴ C08G 59/68	(11) 공개번호 (43) 공개일자	특 1987-0010101 1987년 11월 30일
(21) 출원번호	특 1987-0004122	
(22) 출원일자	1987년 04월 28일	
(30) 우선권주장	858311 1986년 04월 30일 미국(US)	
(71) 출원인	셀 인터나초나이에 레사아치 마아츠사피 비이부이 오노 알버어스 네델란드왕국 헤이그시 2596 에이취아아르 카레르 반 부란트란 30	
(72) 발명자	해리 프랭크	
(74) 대리인	미합중국 텍사스주 휴스턴시 퀸즈 베리 13814 차윤근, 차순영	

심사청구 : 없음

(54) 포스포늄 염 촉매의 비활성화와 고급화 에폭시 수지의 제조

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

포스포늄 염 촉매의 비활성화와 고급화 에폭시 수지의 제조

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1

하이드로카빌 포스포늄 염촉매와 설폰산을 접촉시키는 것으로 구성되는 상기 촉매를 비활성화시키는 방법.

청구항 2

제 1항에 있어서, 설폰산이 툴루엔설폰산 또는 메탄 설폰산인 방법.

청구항 3

제 1항 또는 제 2항에 있어서, 하이드로카빌 포스포늄 염 촉매가 메틸렌 비스(트리페닐 포스포늄 할로겐 화물)인 방법.

청구항 4

제 1항 내지 제 3항 중 어느 하나에 있어서, 설폰산이 하이드로카빌 포스포늄 염촉매의 당량당 대략 0.05 내지 2.0 당량의 양으로 채택되는 방법.

청구항 5

다음 두 단계로 구성되는, 고급화 에폭시 수지를 제조하는 방법 : -반응 혼합물 내에서, 평균적으로 분자당 1개 이상의 1,2-에폭사이드기와 500 이하의 에폭시 당량을 갖는 폴리에폭사이드를 페놀, 티오페놀, 카복실산 및 카복실산 무수물로 이루어지는 군에서 선택된 용합 화합물과 촉매량의 하이드로카빌 포스포늄 염촉매의 존재하에서 100°C 내지 200°C 범위 내의 온도에서, 500 이상의 에폭시 당량을 갖는 에폭시 수지를 생성하기에 충분한 시간동안 접촉시키고, -그 후, 하이드로카빌 포스포늄 염촉매의 활성을 감소시키기 위해 효과적인 양의 설폰산을 반응 혼합물에 가하는 단계.

청구항 6

제 5항에 있어서, 설폰산이 반응 혼합물에 하이드로카빌 포스포늄 염촉매 몰당 0.05 내지 2.0몰의 양으로 첨가되는 방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.